Searching PAJ

第1頁,共1頁

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-156605

(43)Date of publication of application: 30.05.2003

(51)Int.Cl.

GO2B 5/02 5/30 GO2B

602F 1/1335

(21)Application number: 2001-357945

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

22.11.2001

(72)Inventor: MOTO TAKAHIRO

## (54) LIGHT SCATTERING FILM, POLARIZING PLATE AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE USING THEM

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polarizing plate with which thickness of a liquid crystal display device is not increased, a viewing angle of the device is widened, any lowering of contrast, any reversal of gray scale or of black and white, any hue variation and so on are hardly caused by viewing angle variation when applied to the device, which is furthermore free from hard spot-like planar defect and brings about a display screen with excellent quality and planar uniformity when applied to the liquid crystal display device, a light scattering film used for the polarizing plate and the liquid crystal display device equipped with the polarizing plate.

SOLUTION: In the light scattering film having a light scattering layer comprising a translucent scattering agent dispersed in a translucent resin binder with a refractive index different from that of the binder on a transparent substrate, the light scattering layer has 15-80% internal haze value hi caused by internal diffusion, a particle size distribution curve of the translucent scattering agent contained in the light scattering layer has two or more peaks and a group of particles exhibiting a peak with the largest particle diameter satisfies a specified condition. The polarizing plate and the liquid crystal display device using the light scattering film are described.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

09.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

23.08.2006

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特閣2003-156605 (P2003-156605A)

(43)公開日 平成15年5月30日(2003.5.30)

		·		(43)公開日	平成15年 8	Haup	(2003. 5. 30)
(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			7-7	コード(参考)
G02B	5/02		G 0 2 B	5/02		В 2	2H042
GUZD	3/02				•	C 2	H049
	5/30			5/30		2	H091
C C C F	1/1335		G02F	1/1335			
G02F	1/1333		0021	.,	510		
		510	水醋查毒	未請求		OL	(全 18 頁)
(21) 出願番号		特膜2001-357945(P2001-357945)	(71) 出願人	富士写真フイルム株式会社			
(22)出籍日		平成13年11月22日(2001.11.22)	(72)発明者	本 隆裕	足柄市中部   足柄市中部   式会社内		
	-		(74)代理人	100105647 弁理士 小	薬 昌平	<i>G</i> 14:	名)
		•	·				•

最終質に続く

# (54) [発明の名称] 光散乱フィルム、偏光板およびそれを用いた液晶表示装置

# (57)【要約】

【課題】液晶表示装置の厚みを厚くすることなく、視野角を拡大し、視角変化によるコントラスト低下、階調または黒白反転、色相変化等がほとんど発生することがなく、しかもブツ状の面状欠陥がなく、液晶表示装置に適用したときに、品位および面状均一性に優れた表示画面を与える個光板、上記偏光板に用いられる光散乱フィルム、および上記偏光板を備えた液晶表示装置を提供す

【解決手段】透明基材上に、透光性樹脂バインダーに該バインダーと屈折率が異なる透光性拡散剤が分散した光散乱層を有する光散乱フィルムにおいて、光散乱層の内部拡散による内部へイズ値hiが15~80%であり、光散乱層に含有される透光性拡散剤の粒度分布曲線が二つ以上のビークを有し、粒径が最も大きいビークを示す粒子群が特定の条件を満たす光散乱フィルム、それを用いた偏光板および液晶表示装置。

(2)

特開2003-156605

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基材上に、透光性樹脂パインダーに 該パインダーと屈折率が異なる透光性拡散剤が分散した 光散乱層を有する光散乱フィルムにおいて、光散乱層の 内部拡散による内部へイズ値hiが15~80%であ り、光散乱層に含有される透光性拡散剤の粒度分布曲線 が二つ以上のビークを有し、粒径が最も大きいビークを 示す粒子群が下記の条件(i)~(iii)を満たすこと を特徴とする光散乱フィルム。

(i) コールター法で測定した数平均粒径が2.0~ 3.8 μ m の範囲にあること。

(ii) 数平均粒径より3.  $0 \mu m以上大きな粗大粒子を含有する割合が5個/<math>1 \times 10^8$ 個未満であること。

(iii) 粒径の標準偏差が該数平均粒径の25%以下であること。

【請求項2】 内部拡散による内部へイズ値hiが、3 5~70%であることを特徴とする請求項1に記載の光 散乱フィルム。

【請求項3】 光散乱層の表面凹凸による表面へイズ値 hsが、0.5~30%であることを特徴とする請求項 20 1または2に記載の光散乱フィルム。

【請求項4】 光散乱層の表面凹凸による表面へイズ値 hsと光散乱層の内部拡散による内部へイズ値hiとの 和が、30~90%であることを特徴とする請求項3に 記載の光散乱フィルム。

【請求項5】 光散乱層の透光性樹脂バインダーが、3 個以上のエチレン性不飽和基を有する(メタ)アクリレートモノマーを含有する組成物の熱硬化物または電離放射線硬化物であり、かつバインダーの屈折率が1.51~2.00の範囲にあることを特徴とする簡求項1~4 30のいずれかに記載の光散乱フィルム。

【請求項6】 光散乱層の表面凹凸の表面粗さRaが、 0.02~1.00μmであることを特徴とする請求項 1~5のいずれかに記載の光散乱フィルム。

【請求項7】 光散乱層における透光性樹脂バインダーと透光性拡散剤との屈折率の差△nが、0.02~0.80であることを特徴とする請求項1~6のいずれかに配載の光散乱フィルム。

【請求項8】 液晶性化合物からなる光学異方性層、偏 光子および光散乱フィルムを有する偏光板において、該 40 光散乱フィルムが請求項1~7のいずれかに記載の光散 乱フィルムであることを特徴とする偏光板。

【請求項9】 液晶性化合物がディスコティック化合物であることを特徴とする請求項8に記載の優光板。

【請求項10】 光学異方性層と順光子の間及び偏光子と光散乱層の間にそれぞれ少なくとも1枚のセルロースアセテートフィルムを有することを特徴とする請求項8または9に記載の偏光板。

【請求項11】請求項8~10のいずれかに記載の偏光 板の光学異方性層側を液晶セル面に配置したことを特徴 50 とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】本発明は、光散乱フィルム、偏光板、およ び該偏光板を用いた液晶表示装置に関する。

2

[0002]

【従来の技術】一般に液晶表示装置は、偏光板と液晶セ ルから構成されている。液晶表示装置の表示品位上の欠 点は狭い視野角と外光の写り込みであり、これらの欠点 のないものが望まれ、加えて面状欠陥のないものが望ま 10 れている。視野角に関しては、現在主流であるTNモー ドTFT液晶表示装置において、特開平8-50206 号公報、特開平7-191217号公報、およびに欧州 特許0911656A2号明細書に記載のように光学補 償フィルムを偏光板と液晶セルの間に挿入し、極めて広 視野角の液晶表示装置が実現されている。ところが、上 記液晶表示装置はパネルの下方向の階調反転が生じると いう問題が残っていた。この問題に対して、特許第28 22983号には光拡散手段を、特開2001-337 83号公報には光軸変換板を、および特別2001-5 6461号公報には出射光を拡散する光学手段を、視認 側表面に設けることで著しく表示品位が改善されること が提案されている。しかしながら、これらに記載の具体 的手段は高度に制御されたレンズ構造、あるいは回折構 造を有する光拡散手段であり、高価、かつ大量生産が非 常に困難であった。

【0003】安価、かつ大量生産可能な光散乱フィルムとしては、例えば特開平6-18706号公報、特開平10-20103号公報等に開示されるように、透明基材フィルムの表面に、二酸化ケイ素(シリカ)等のフィラーを含む樹脂を塗工して形成したもの、その他特開平11-160505号公報、特開平11-305010号公報、特開平11-326608号公報、特開2000-121809号公報、特開2000-180611号公報、および特別2000-338310号公報等で提案されたものが挙げられる。しかしながら、これらのように塗工により光拡散層を形成しようとするとフィルム全面にブツ状の面状欠陥を引き起こすことが分かった。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、特に 個光子および液晶性化合物からなる光学異方性層とを有 する偏光板に用いると、視野角(特に下方向視野角)を 拡大し、視角変化によるコントラスト低下、階調または 黒白反転、色相変化等がほとんど発生することがなく、 しかもブツ状の面状欠陥がなく、液晶表示装置に適用し たときに、品位および面状均一性に優れた表示画面を与 える光散乱フィルム及びそれを用いた優光板を提供する ことにある。本発明の他の目的は、上記性能に優れた安 価な偏光板を備えた液晶表示装置を提供することにあ (3)

特開2003-156605

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、下記構 成の光散乱フィルム、偏光板、および液晶表示装置によ り達成される。

- 1. 透明基材上に、透光性樹脂バインダーに該バインダ ーと屈折率が異なる透光性拡散剤が分散した光散乱層を 有する光散乱フィルムにおいて、光散乱層の内部拡散に よる内部へイズ値hiが15~80%であり、光散乱層 に含有される透光性拡散剤の粒度分布曲線が二つ以上の 下記の条件(i)~(iii)を満たすことを特徴とする 光散乱フィルム。
- (i) コールター法で測定した数平均粒径が2.0~ 3.8 µmの範囲にあること。
- (ii) 数平均粒径より3.0 μm以上大きな粗大粒子を 含有する割合が5個/1×108個未満であること。
- (iii) 粒径の標準偏差が該数平均粒径の25%以下で あること。
- 2. 内部拡散による内部へイズ値h i が、35~70% であることを特徴とする上記1に記載の光散乱フィル
- 3. 光散乱層の表面凹凸による表面へイズ値hsが、
- 0.5~30%であることを特徴とする上記1または2 に記載の光散乱フィルム。
- 4. 光散乱層の表面凹凸による表面へイズ値hsと光散 乱層の内部拡散による内部ヘイズ値hiとの和が、30 ~90%であることを特徴とする上記3に記載の光散乱
- 5. 光散乱層の透光性樹脂バインダーが、3個以上のエ チレン性不飽和基を有する(メタ)アクリレートモノマ 30 ーを含有する組成物の熱硬化物または電離放射線硬化物 であり、かつバインダーの屈折率が1.51~2.00 の範囲にあることを特徴とする上記1~4のいずれかに 記載の光散乱フィルム。
- 6. 光散乱層の表面凹凸の表面粗さRaが、0.02~ 1.00µmであることを特徴とする上記1~5のいず れかに記載の光散乱フィルム。
- 7. 光散乱層における透光性樹脂バインダーと透光性拡 散剤との屈折率の差△nが、0.02~0.80である ことを特徴とする上記1~6のいずれかに記載の光散乱
- 8. 液晶性化合物からなる光学異方性層、偏光子および 光散乱フィルムを有する偏光板において、該光散乱フィ ルムが上記1~7のいずれかに記載の光散乱フィルムで あることを特徴とする偏光板。
- 9. 液晶性化合物がディスコティック化合物であること を特徴とする上記8に記載の個光板。
- 10. 光学異方性層と原光子の間及び順光子と光散乱層 の間にそれぞれ少なくとも1枚のセルロースアセテート フィルムを有することを特徴とする上記8または9に記 50 いと面ギラが発生し易い。面ギラの発生を低下させる観

載の優光板。

11. 上記8~10のいずれかに記載の隔光板の光学異 方性層側を液晶セル面に配置したことを特徴とする液晶 表示装置。

100061

【発明の実施の形態】本発明は、偏光板全面のブツ状の 面状欠陥が光拡散層に添加する粒子の粗大粒子や環境等 から混入した異物の混入等に起因すること、および光拡 散層の内部散乱と表面散乱の添加粒子の粒径や粒度分布 ピークを有し、粒径が最も大きいピークを示す粒子群が 10 に対する許容度が狭いことを見いだしたことに基づくも のである。以下、本発明の実施の形態につき詳細に説明 する。本発明の偏光板は、液晶性化合物から成る光学異 方性層、偏光子、および透光性樹脂バインダーに該樹脂 バインダーと屈折率が異なる透光性拡散剤が分散した光 散乱層を有する光散乱フィルムを含んでなる。 本発明の 好ましい 偏光板の層構成の 概略断面図を図1に模式的に 示した。透明基材フィルム2の一方の面(図において上 面) に、光散乱層5が積層され、透明基材フィルム2の 反対面 (図においては下面) に、 偏光子6、 透明基材フ ィルム7及び光学異方性層8が積層されている。本発明 の光散乱フィルムは、透明基材フィルム2の一方の面 (図において上面) に光散乱層5が積層された構造体に 相当する。なお、本発明の偏光板の層構成は、図1に示 されているものに制限されず、多くのバリエーションが あることは勿論のことである。以下、図1に基づいて本 発明の偏光板を構成する各層について説明する。

> 【0007】 (光散乱層) 本発明の偏光板に設けられる 光散乱層5は、光を拡散させ以下に示す光学異方性層と 組み合わせることで液晶ディスプレイの下方向の視野角 を拡大させるための層である。光散乱層5としては、上 記したように、透光性樹脂パインダーに、該樹脂と屈折 率が異なる透光性拡散剤が分散した光散乱層5であり、 いわゆる内部光散乱層である。このような構成であれば 内部に屈折率分布を有していてもよい。本発明の偏光板 に内部光散乱層を用いる方法について具体的に記載す

> 【0008】光散乱層5の内部拡散による内部ヘイズ値 hiは15~80%であり、これにより液晶表示装置の 下方視野角を改善することができ、かつ面ギラを低下さ せることができる。ここで、面ギラとは、いわゆるシン チレーションであり、キラキラ光る輝きが発生する現象 をいう。光散乱層5の表面のヘイズ値hsは、低いほど 表示のポケを小さくして明瞭なディスプレイ表示を得る ことができるが、ヘイズ値が低すぎると映り込み及び面 ギラが発生する。反対に、高すぎると白っぽくなりる白 化 (黒濃度低下) が起こる。このような観点から、表面 ヘイズ値h s は、0.5~30%が好ましく、3~20 %が更に好ましく、 $7 \sim 15$ %が最も好ましい。また、 表面ヘイズ値hsを最適にしても内部ヘイズ値hiが低

(4)

点から、光散乱層5の内部ヘイズ値hiは、好ましくは 35~70%、より好ましくは40~60%である。

【0009】さらに、本発明の偏光板では、光散乱層5 における表面へイズ値hsと内部へイズ値hiとの和が 30~90%となるように光散乱層5を形成することに より、面ギラ発生の抑制の点で、更に大きな効果を得る ことができる。

【0010】表面ヘイズ値hsは、通常、光散乱層5中 に含有する傲粒子により樹脂層表面に適度な凹凸を設け

【OOll】表面ヘイズ値hsを所望の値とするには、 光散乱層の表面に微細な凹凸を形成することが好まし い。具体的には、光散乱層の表面に表面粗さRaがO. 02~1.00µmの凹凸を形成することが好ましい。 このような微細な凹凸を付与するには、透明基材フィル ム2に対して、透光性拡散剤3と透光性樹脂バインダー 4との混合物の塗布液を塗布し、形成された塗布層の上 に、表面に表面相さRaが0.02~1.00µmの微 細な凹凸を有する賦型フィルムを、該表面が前記塗布層 20 に接するように積層し、透光性樹脂バインダー4が電子 級あるいは紫外線硬化型樹脂の場合は、電子線あるいは 紫外線を賦型フィルムを介して照射して硬化した後に、 一方透光性樹脂バインダー4が溶剤乾燥型樹脂の場合 は、加熱、乾燥した後に、賦型フィルムを光散乱層5か ら剥離することによって、光散乱層表面に凹凸が形成さ れる。即ち、このような方法で、散乱層5表面に、賦型 フィルムに子め形成されている表面粗さRaがO.02 ~1.00μmの細かな凹凸が転写される。また、別法 として、所望のRa値は、塗布液の塗布量(完成後の樹 30 脂厚み)と拡散剤粒径、粒度分布によっても調整するこ とができる。

【0012】内部ヘイズ値h i 、表面ヘイズ値h s およ びこれらの値の和を上記のようにするためには、飲乱層 5を構成する透光性樹脂バインダー4の屈折率と透光性 拡散剤3の屈折率の差△nが0.02~0.80である ことが好ましい。屈折率差△nが0.01以下である と、散乱層5における光拡散性を発現するには非常に多 くの拡散剤である透光性拡散剤を透光性樹脂バインダー 中に含有させなければならず、このようにすると散乱層 40 5の透明基材フィルム2への接着性及び竣工適性が悪化 する。また、△nが0.81以上の場合は、透光性樹脂 バインダー4中の透光性拡散剤3の含有量が少なくな り、均一で適度な凹凸を持つ散乱層5が得られず、いず れにせよ好ましくない。

【0013】光散乱層には、少なくとも1種類以上の透 光性樹脂粒子が拡散剤として用いられる。その中で最も 大きい粒子群の平均粒径はコールター法による数平均粒 径で2.0~3.8µmが好ましく、より好ましくは

光散乱性に劣り、好ましくない、3.8μmを超えると 散乱層5の内部における拡散効果が減少するため内部へ イズ値が低下し面ギラが発生しやすく、更に膜厚が厚く なるため透光性樹脂パインダー4の製造過程における硬 化収縮が増大し、割れやカールを生じる等のトラブルが 発生し、好ましくない。さらに、透過像鮮明性も悪化す る。また、樹脂粒子の最も大きい粒子群の粒度分布は、 粒径の標準偏差が数平均粒径の25%以下であることが 好ましく、20%以下がより好ましい。これが25%を ることにより所望の値とすることができ、これが好まし 10 超えると、各樹脂粒子に対するバインダーの被覆形態が 不均一になり、所望の表面凹凸を形成できない。

> 【0014】また、樹脂粒子の最も大きい粒子群は、粒 径が数平均粒径より3.0μm以上大きな粗大粒子を含 有する割合が5個/1×108個未満であることが好ま しい。このような粗大粒子は、本発明の光拡散性偏光板 においては、ブツ状の面状欠陥の核になることから、望 ましくは一切含まれないことがより好ましい。これが5 個 $/1 \times 10^8$ 個以上では、 $1 m^2$ あたりのブツ状欠陥数 が許容レベルを超えてしまい、本発明の光拡散性偏光板 の製造得率が悪化し、好ましくない。

【0015】内部ヘイズ値hi、表面ヘイズ値hsおよ びこれらの値の和を上記のように調整する方法として は、例えば、透光性拡散剤3と透光性樹脂パインダー4 との比であるフィラー (P) /バインダー (V) 比を調 整する方法、P、Vの屈折率差を調整する方法、溶剤の 種類を調整する方法等が挙げられる。

【0016】散乱層5を構成する透光性樹脂パインダー 4としては、主として紫外線・電子線によって硬化する 樹脂、即ち、電離放射線硬化型樹脂、電離放射線硬化型 樹脂に熱可塑性樹脂と溶剤を混合したもの、熱硬化型樹 脂の3種類が使用される。ここで、電離放射線硬化型樹 脂、電離放射線硬化型樹脂および熱硬化型樹脂は、被膜 形成成分としての硬化前のモノマー、オリゴマー状の化 合物、あるいはプレポリマーを含有する樹脂組成物を意 味している。

【0017】電離放射線硬化型樹脂の被膜形成成分は、 好ましくは、アクリレート系の官能基を有するもの、例 えば比較的低分子量のポリエステル樹脂、ポリエーテル 樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、ア ルキッド樹脂、スピロアセタール樹脂、ポリプタジエン 樹脂、ポリチオールポリエン樹脂、多価アルコール等の 多官能化合物の(メタ)アルリレート等のオリゴマーま たはプレポリマー;及び反応性希釈剤としてエチル(メ タ) アクリレート、エチルヘキシル(メタ)アクリレー ト、スチレン、メチルスチレン、Nービニルピロリドン 等の単官能モノマー並びに多官能モノマー、例えば、ポ リメチロールプロパントリ (メタ) アクリレード、ヘキ サンジオール (メタ) アクリレート、トリプロピレング リコールジ (メタ) アクリレート、ジエチレングリコー 2.3~3.5μmである。これが2.0μm未満だと 50 ルジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ

(メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート、1,6-ヘキサンジオールジ (メタ) アクリレート、ネオペンチルグリコールジ (メ タ) アクリレート等を比較的多量に含有するものが使用 できる。更に、上記電離放射線硬化型樹脂を紫外線硬化 型樹脂とするには、この中に光重合開始剤としてアセト フェノン類、ベンゾフェノン類、ミヒラーペンゾイルベ ンゾエート、αーアミロキシムエステル、テトラメチル チュウラムモノサルファイド、チオキサントン類や、光 **増密剤として n ーブチルアミン、トリエチルアミン、ボ 10 剤、重合促進剤、溶剤、粘度調整剤等を加えて使用す** リーnーブチルホソフィン等を混合すればよい。特に本 発明では、オリゴマーとしてウレタンアクリレート、モ ノマーとしてジペンタエリストリトールヘキサ(メタ) アクリレート等を混合するのが好ましい。

【0018】更に、散乱層5を形成するための透光性樹 脂バインダー4として、上記した電離放射線硬化型樹脂 に溶剤乾燥型樹脂が含有されていてもよい。溶剤乾燥型 樹脂には、主として熱可塑性樹脂が用いられる。電離放 射線硬化型樹脂に添加する溶剤乾燥型熱可塑性樹脂の種 類は特に制限されないが、透明基材フィルム2として後 20 述するTAC等のセルロース系樹脂を用いるときには、 電離放射線硬化型樹脂に含有される溶剤乾燥型樹脂に は、ニトロセルロース、アセチルセルロース、セルロー スアセテートプロピオネート、エチルヒドロキシエチル セルロース等のセルロース系樹脂が強膜の密着性及び透 明性の点で有利である。その理由は、例えば上記のセル ロース系樹脂に溶媒として好ましいトルエンを使用した 場合に、透明基材フィルム2であるポリアセチルセルロ ースの非溶解性の溶剤であるトルエンを用いるにも拘ら ず、透明基材フィルム2にこの溶剤乾燥型樹脂を含む塗 30 料の塗布を行っても、透明基材フィルム2と塗膜樹脂と の密着性を良好にすることができ、しかもこのトルエン は、透明基材フィルムであるポリアセチルセルロースを 溶解しないので、該透明基材フィルム2表面は白化せ ず、透明性が保たれるという利点があるからである。

【0019】更に、次のように、電離放射線硬化型樹脂 に溶剤乾燥型樹脂を含ませる利点がある。電離放射線硬 化型樹脂をメタリングロールを有するロールコータで透 明基材フィルム2に塗布する場合、メタリングロール表 面の液状残留樹脂膜が流動して経時で筋やムラ等にな り、これらが塗布面に再転移して塗布面に筋やムラ等の 欠点を生じるが、上記のように電離放射線硬化型樹脂組 成物に溶剤乾燥型樹脂を含ませると、このような塗布面 の塗膜欠陥を防ぐことができる。

【0020】上記のような電解放射線硬化型樹脂の硬化 方法としては、前記電離放射線硬化型樹脂硬化方法は通 常の硬化方法、即ち、電子線又は紫外線の照射によって 硬化することができる。 具体的には、数十KeVのエネ ルギーを有する電子誤等が使用され、紫外線硬化の場合 には超高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボン・50

アーク、キセノンアーク、メタルハライドランプ等の光 線から発する紫外線等が利用できる。

【0021】電離放射線硬化型樹脂に混合される熱可塑 性樹脂としては、フェノール樹脂、尿素樹脂、ジアリル フタレート樹脂、メラニン樹脂、グアナミン樹脂、不飽 和ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹 脂、アミノアルキッド樹脂、メラミン-尿素共縮合樹 脂、ケイ素樹脂、ポリシロキサン樹脂等が使用され、こ れらの樹脂に必要に応じて架橋剤、重合開始剤等の硬化

【0022】散乱層5に含有させる透光性拡散剤3とし ては、プラスチックビーズが好適であり、特に透明度が 高く、透光性樹脂バインダー4との屈折率差が前述のよ うな数値になるものが好ましい。プラスチックビーズと しては、スチレンビーズ(屈折率1.60)、架橋スチ レンビーズ(屈折率1.61)、ベンゾグアナミンビー ズ (屈折率1.68)、メラミンビーズ (屈折率1.5 7)、アクリルビーズ (屈折率1.49)、PMMAビ ーズ (屈折率1.49)、アクリルースチレンビーズ (屈折率1.54)、ポリカーボネートビーズ(屈折率 1.57)、ポリエチレンピーズ(屈折率1.49)、 塩化ビニルビーズ (屈折率1.60) 等が用いられる。 これらのプラスチックビーズの粒径は、1.0~3.8 μmのものを適宜選択して用いる。

【0023】上記のような有機フィラーとしての透光性 拡散剤3を添加する際には、硬化前の樹脂中で有機フィ ラーが沈降し易いので、沈降防止のために、さらに屈折 **率調整のためにアルミニウム、ジルコニウム、亜鉛、チ** タン、インジウム、及び錫から選ばれる金属の酸化物超 **微粒子あるいはケイ素の酸化物超微粒子を添加すること** ができる。光散乱層のバインダーはこれら酸化物超微粒 子と3個以上のエチレン性不飽和基を有する(メタ)ア クリレートモノマーとの混合物を含有する組成物の熱硬 化物または電離放射線硬化物であることが好ましく、塗 膜の透明性が損なわないためにバインダーの屈折率が 1.51~2.00の範囲にあることが好ましい。特に 2.00より大きいと反射光に色がつき品位が悪くな る.

【0024】ここで、一般に、電離放射線硬化型樹脂の 硬化樹脂の屈折率は1.51~2.00で、ガラスと同 程度であるが、透光性拡散剤3の屈折率との比較におい て、用いる硬化樹脂の屈折率が低い場合には、透光性樹 脂バインダー4に、屈折率の高い微粒子であるTiOz (屈折率; 2.3~2.7)、Y2O3(屈折率; 1.8 7)、La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(屈折率; 1、95)、ZrO<sub>2</sub>(屈折 率; 2. 05)、Al2O3 (屈折率; 1. 63) 等を塗 膜の拡散性を保持できる程度に加えて、屈折率を上げて 調整することができる.

【0025】光散乱層5が形成される透明基材フィルム

特開2003-156605 10

2の繁材としては、透明樹脂フィルム、透明樹脂板、透明樹脂シートや透明ガラスが挙げられる。透明樹脂フィルムとしては、トリアセテートセルロース(TAC)フィルム、ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、ジアセチルセルロースフィルム、アセテートブチレートセルロースフィルム、ポリエーテルサルホンフィルム、ボリアクリル系樹脂フィルム、ポリカーボネートフィルム、ボリスルホンフィルム、ポリエーテルフィルム、ポリメチルペンテンフィルム、ボリエーテルケトンフィルム、(メタ)アクリルロニトリルフィルム等が使用できる。また、厚さは通常25~1000μm程度である。

【0026】本発明の優光板を液晶表示装置に適用する場合、透明基材フィルム2には、複屈折がないTACが、散乱フィルムと優光素子との務層を可能とし(詳しくは後述する)、更にその散乱フィルムを用いて表示品位の優れた表示装置を得ることができるので、特に好ましい。以上、光散乱層について説明した。次に、本発明の偏光板を構成する光学異方性層について説明する。【0027】〔光学異方性層〕光学異方性層は液晶性化合物を含んでなる。

(液晶性化合物) 本発明の偏光板に用いられる液晶性化 合物はディスコティック化合物(ディスコティック液 晶) が好ましく用いられる。ディスコティック液晶の例 としては、C. Destradeらの研究報告、Mo · I. Cryst. 71巻、111頁(1981年)に記 載されているベンゼン誘導体、C. Destradeら の研究報告、Mol. Cryst. 122巻、141頁 (1985年)、Physics lett, A. 78 巻、82頁(1990)に記載されているトルキセン誘 導体、B. Kohneらの研究報告、Angew. Ch em. 96巻、70頁(1984年)に記載されたシク ロヘキサン誘導体及びJ.M.Lehnらの研究報告、 J. Chem. Commun., 1794頁(1985 年)、J. Zhangらの研究報告、J. Am. Che m. Soc. 116巻、2655頁(1994年)に記 載されているアザクラウン系やフェニルアセチレン系マ クロサイクルなどを挙げることができる。ディスコティ ック液晶は、一般的にこれらを分子中心の母核とし、直 40 鎖のアルキル基やアルコキシ基、置換ベンゾイルオキシ 基等が未端基として置換され、これらが放射線状にのび た構造であり、液晶性を示す。ただし、分子自身が負の 一軸性を有し、一定の配向を付与できるものであれば上 記記載に限定されるものではない。

【0028】また、本発明において、液晶性化合物からなる光学異方性層の「液晶性化合物」は、本発明の偏光板を構成する光学異方性層において、液晶性である必要はなく、例えば、上記低分子ディスコティツク液晶が然、光等で反応する基を有しており、結果的に熱、光等

で反応により重合または架橋し、高分子量化し液晶性を 失って光学異方性層を形成していてもよい。上記ディス コティック液晶の好ましい例は特闘平8-50206号 公報に記載されている。

【0029】本発明の優光板を構成する光学異方性層は、好ましくはディスコティック構造を有する化合物からなる負の被屈折を有する層であって、そしてディスコティック構造の面が、透明基材面に対して傾き、且つ該ディスコティック構造の面と透明基材面とのなす角度が、光学異方層の深さ方向に変化していることが好ましい

【0030】上記ディスコティック構造の面の角度(傾斜角)は、一般に、光学異方層の深さ方向でかつ光学異方層の底面からの距離の増加と共に増加または減少している。上記傾斜角は、距離の増加と共に増加することが好ましい。間欠的増加、間欠的減少、違続的増加、連続的減少を含む変化、及び増加及び減少を含む間欠的変化等を挙げることができる。間欠的変化は、厚さ方向の途中で傾斜角が変化しない領域を含んでいる。傾斜角は、変化しない領域を含んでいても、全体として増加または減少していることが好ましい。更に、傾斜角は全体として増加していることが好ましく、特に連続的に変化することが好ましい。

【0031】上記光学異方層は、一般にディスコティッ ク化合物及び他の化合物を溶剤に溶解した溶液を配向膜 上に塗布し、乾燥し、次いでディスコティックネマチッ ク相形成温度まで加熱し、その後配向状態(ディスコテ ィックネマチック相)を維持して冷却することにより得 られる。あるいは、上記光学異方層は、ディスコティッ ク化合物及び他の化合物(更に、例えば重合性モノマ 一、光重合開始剤)を溶剤に溶解した溶液を配向膜上に 塗布し、乾燥し、次いでディスコティックネマチック相 形成温度まで加熱したのち重合させ(UV光の照射等に より)、さらに冷却することにより得られる。本発明に 用いるディスコティック液晶性化合物のディスコティッ クネマティック液晶相 - 固相転移温度としては、70~ 300℃が好ましく、特に70~170℃が好ましい。 【0032】光学異方性層の透明基材フィルム7側のデ ィスコティック構造の傾斜角は、一般にディスコティッ ク化合物あるいは配向膜の材料を選択することにより、 またはラビング処理方法の選択することにより、調整す ることができる。また、反対面側(空気側)のディスコ ティック構造の傾斜角は、一般にディスコティック化合 物あるいはディスコティック化合物とともに使用する他 の化合物(例、可塑剤、界面活性剤、重合性モノマー及 びポリマー)を選択することにより調査することができ る。更に、傾斜角の変化の程度も上記選択により調整す ることができる。

【0033】上記可塑剤、界面活性剤及び重合性モノマ

ーとしては、ディスコティック化合物と相溶性を有し、 液晶性ディスコティック化合物の傾斜角の変化を与えら れるか、あるいは配向を阻害しない限り、どのような化 合物も使用することができる。これらの中で、重合性モ ノマー (例、 ビニル基、 ビニルオキシ基、 アクリロイル **基及びメタクリロイル基を有する化合物)が好ましい。** 上記化合物は、ディスコティック化合物に対して一般に 1~50質量% (好ましくは5~30質量%) の量にて

11

る上記ポリマーとしては、ディスコティック化合物と相 溶性を有し、液晶性ディスコティック化合物に傾斜角の 変化を与えられる限り、どのようなボリマーでも使用す ることができる。ポリマー例としては、セルロースエス テルを挙げることができる。セルロースエステルの好ま しい例としては、セルロースアセテート、セルロースア セテートプロピオネート、ヒドロキシプロピルセルロー ス及びセルロースアセテートブチレートを挙げることが できる。上記ポリマーは、液晶性ディスコティック化合 物の配向を阻害しないように、ディスコティック化合物 20 に対して一般に0.1~10質量%(好ましくは0.1 ~8質量%、特に好ましくは0.1~5質量%)の量で 使用される.

【0035】本発明で用いられる液晶性化合物からなる 光学異方性層は、透明基材フィルム7としてのセルロー スアセテートフィルム、その上に設けられた配向膜の上 に配置される。配向膜は架構されたポリマーからなるラ ピング処理された膜である。本発明で用いられる配向膜 の好ましい例としては、図1に示した構成や特開平9-152509号公報に記載の配向膜が挙げられる。

【0036】(透明基材フィルム)上記透明基材フィル ムクとしてのセルロースアセテートフィルムとしては、 酢化度が59.0~61.5%であるセルロースアセテ ートが好ましい。酢化度とは、セルロース単位質量当た りの結合酢酸量を意味する。酢化度は、ASTM:D-817-91 (セルロースアセテート等の試験法) にお けるアセチル化度の測定および計算に従う。セルロース アセテートの粘度平均重合度 (DP) は、250以上で あることが好ましく、290以上であることがさらに好 ましい。また、上記セルロースアセテートは、分子量分 40 布が狭いことが好ましく、ゲルパーミエーションクロマ トグラフィーによる多分散性指数Mw/Mn(Mwは質 量平均分子量、Mnは数平均分子量)としては、1.0 ~1.7であることが好ましく、1.3~1.65であ ることがさらに好ましく、1.4~1.6であることが 最も好ましい。

【0037】一般に、セルロースアセテートの2、3、 6位の水酸基は全体の置換度の1/3づつに均等に分配 されるわけではなく、6位水酸基の置換度が小さくなる 傾向がある。 本発明ではセルロースアセテートの6位水

酸基の置換度が、2.3位に比べて多いセルロースアセ テートを用いることもできる。上記セルロースアセテー トの場合、6位水酸基が多いときは、全体の置換度に対 して6位の水酸基が32%以上アセチル基で置換されて いることが好ましく、更には33%以上、特に34%以 上であることが好ましい。さらにセルロースアセテート の6位アセチル基の置換度が0.88以上であることが 好ましい。セルロースアセテートとして、特開平11-5851号公報記載の段落0043~0044の実施例 【0034】ディスコティック化合物とともに使用され 10 [合成例1]、0048~0049の[合成例2]、0 051~0052の[合成例3]の方法で得られたセル ロースアセテートを用いることができる。

12

【0038】セルロースアセテートフィルムのレターデ ーションを調整するため、少なくとも二つの芳香族環を 有する芳香族化合物をレターデーション上昇剤として使 用することが好ましい。

【0039】芳香族化合物が有する芳香族環の数は、2 ~20であることが好ましく、2~12であることがよ り好ましく、2~8であることがさらに好ましく、2~ 6であることが最も好ましい。二つの芳香族環の結合関 係は、(a)縮合環を形成する場合、(b)単結合で直 結する場合および(c)連結基を介して結合する場合に 分類できる(芳香族類のため、スピロ結合は形成できな い) . 結合関係は、(a)~(c)のいずれでもよい。 芳香族化合物の芳香族環には、芳香族炭化水素環に加え て、芳香族性ヘテロ環を含む。芳香族炭化水素環は、6 員環 (すなわち、ベンゼン環) であることが特に好まし い。芳香族性ヘテロ環は一般に、不飽和ヘテロ環であ る。芳香族性ヘテロ環は、5眞環、6眞環または7眞環 であることが好ましく、5員環または6員環であること がさらに好ましい。芳香族性ヘテロ環は一般に、最多の 二重結合を有する。ヘテロ原子としては、窒素原子、酸 素原子および硫黄原子が好ましく、窒素原子が特に好ま LW.

【0040】上記芳香族性ヘテロ環の例には、フラン 環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール環、イソ オキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イ ミダゾール環、ピラゾール環、フラザン環、トリアゾー ル環、ピラン環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジ ン環、ピラジン環および1、3、5-トリアジン環が含 まれる。芳香族環としては、ベンゼン環、フラン環、チ オフェン環、ピロール環、オキサゾール環、チアゾール 環、イミダゾール環、トリアゾール環、ピリジン環、ピ リミジン環、ピラジン環および1、3、5ートリアジン 環が好ましく、ベンゼン環および1,3,5ートリアジ ン環がさらに好ましい。芳香族化合物は、少なくとも一 つの1、3、5ートリアジン環を有することが特に好ま しい。このようなレターデーション上昇剤は、セルロー スアセテート100質量部に対して、0.01~20質 50 量部の範囲で、好ましくは0.05~15質量部の範囲 (8)

特開2003-156605

で、より好ましくは0.1~10質量部の範囲で使用さ れる。二種類以上のレターデーション上昇剤を併用して もよい、レターデーション上昇剤の具体例としては、特 開2000-111914号公報、同2000-275 434号公報、PCT/JP00/02619号明細書 に記載の化合物が挙げられる。

13

【0041】以上述べたセルロースアセテートフィルム の製造方法について説明する。上記セルロースアセテー トフィルムは、ソルベントキャスト法によりを製造する ことが好ましい。ソルベントキャスト法では、セルロー 10 スアセテートを有機溶媒に溶解した溶液(ドープ)を用 いてフィルムを製造する。有機溶媒は、炭素原子数が3 ~12のエーテル、炭素原子数が3~12のケトン、炭 紫原子数が3~12のエステルおよび炭素原子数が1~ 6のハロゲン化炭化水素から選ばれる溶媒を含むことが 好ましい。エーテル、ケトンおよびエステルは、環状構 造を有していてもよい。エーテル、ケトンおよびエステ ルの官能基(すなわち、一〇一、一〇〇一および一〇〇 〇-)のいずれかを二つ以上有する化合物も、有機溶媒 として用いることができる。 有機溶媒は、アルコール性 水酸基のような他の官能基を有していてもよい。二種類 以上の官能基を有する有機溶媒の場合、その炭素原子数 は、いずれかの官能基を有する化合物の規定範囲内であ ればよい。

[0042] 炭素原子数が3~12のエーテル類の例に は、ジイソプロピルエーテル、ジメトキシメタン、ジメ トキシエタン、1、4ージオキサン、1、3ージオキソ ラン、テトラヒドロフラン、アニソールおよびフェネト ールが含まれる。 炭素原子数が3~12のケトン類の例 には、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケト ン、ジイソブチルケトン、シクロヘキサノンおよびメチ ルシクロヘキサノンが含まれる。炭素原子数が3~12 のエステル類の例には、エチルホルメート、プロビルホ ルメート、ペンチルホルメート、メチルアセテート、エ チルアセテートおよびペンチルアセテートが含まれる。 二種類以上の官能基を有する有機溶媒の例には、2-エ トキシエチルアセテート、2-メトキシエタノールおよ び2-ブトキシエタノールが含まれる。ハロゲン化炭化 水衆の炭素原子数は、1または2であることが好まし のハロゲンは、塩素であることが好ましい。ハロゲン化 炭化水素の水素原子が、ハロゲンに置換されている割合 は、25~75モル%であることが好ましく、30~7 Oモル%であることがより好ましく、35~65モル% であることがさらに好ましく、40~60モル%である ことが最も好ましい。メチレンクロリドが、代表的なハ ロゲン化炭化水素である。二種類以上の有機溶媒を混合 して用いてもよい。

【0043】一般的な方法でセルロースアセテート溶液 を調製できる。一般的な方法とは、OC以上の温度(常

温または高温)で、処理することを意味する。溶液の調 製は、通常のソルベントキャスト法におけるドープの調 **製方法および装置を用いて実施することができる。な** お、一般的な方法の場合は、有機溶媒としてハロゲン化 炭化水素 (特にメチレンクロリド)を用いることが好ま しい。セルロースアセテートの量は、得られる溶液中に 10~40質量%含まれるように調整する。セルロース アセテートの量は、10~30質量%であることがさら に好ましい。有機溶媒(主溶媒)中には、後述する任意 の添加剤を添加しておいてもよい。溶液は、常温(0~ 40℃)でセルロースアセテートと有機溶媒とを撹拌す ることにより調製することができる。高濃度の溶液は、 加圧および加熱条件下で撹拌してもよい。具体的には、 セルロースアセテートと有機溶媒とを加圧容器に入れて 密閉し、加圧下で溶媒の常温における沸点以上、かつ溶 媒が沸騰しない範囲の温度に加熱しながら撹拌する。加 熱温度は、通常は40度以上であり、好ましくは60~ 200度であり、さらに好ましくは80~110度であ

【0044】各成分は予め租混合してから容器に入れて もよい。また、順次容器に投入してもよい。容器は撹拌 できるように構成されている必要がある。窒素ガス等の 不活性気体を注入して容器を加圧することができる。ま た、加熱による溶媒の蒸気圧の上昇を利用してもよい。 あるいは、容器を密閉後、各成分を圧力下で添加しても よい。加熱する場合、容器の外部より加熱することが好 ましい。例えば、ジャケットタイプの加熱装置を用いる ことができる。また、容器の外部にプレートヒーターを 設け、配管して液体を循環させることにより容器全体を 加熱することもできる。容器内部に撹拌翼を設けて、こ れを用いて撹拌することが好ましい。撹拌翼は、容器の 壁付近に達する長さのものが好ましい。撹拌翼の末端に は、容器の壁の液膜を更新するため、掻取翼を設けるこ とが好ましい。容器には、圧力計、温度計等の計器類を 設置してもよい、容器内で各成分を溶剤中に溶解する。 調製したドープは冷却後容器から取り出すか、あるい は、取り出した後、熱交換器等を用いて冷却する。 【0045】冷却溶解法により、溶液を調製することも

できる。冷却溶解法では、通常の溶解方法では溶解させ く、1 であることが最も好ましい。ハロゲン化炭化水素 40 ることが困難な有機溶媒中にもセルロースアセテートを 溶解させることができる。なお、通常の溶解方法でセル ロースアセテートを溶解できる溶媒であっても、冷却溶 解法によると迅速に均一な溶液が得られるとの効果があ る。冷却溶解法では最初に、室温で有機溶媒中にセルロ ースアセテートを撹拌しながら徐々に添加する。セルロ -スアセテートの量は、この混合物中に10~40質量 %含まれるように調整することが好ましい。セルロース アセテートの量は、10~30質量%であることがさら に好ましい。さらに、混合物中には後述する任意の添加 剤を添加しておいてもよい.

(9)

特開2003-156605

15

【0046】次に、混合物を−100~−10℃(好ま しくは-80~-10℃、さらに好ましくは-50~-20℃、最も好ましくは-50~-30℃) に冷却す る。冷却は、例えば、ドライアイス・メタノール浴(-75℃) や冷却したジエチレングリコール溶液 (-30 ~-20℃) 中で実施できる。このように冷却すると、 セルロースアセテートと有機溶媒の混合物は固化する。 冷却速度は、4℃/分以上であることが好ましく、8℃ /分以上であることがさらに好ましく、12℃/分以上 しいが、10000℃/砂が理論的な上限であり、10 00℃/秒が技術的な上限であり、そして100℃/秒 が実用的な上限である。なお、冷却速度は、冷却を開始 する時の温度と最終的な冷却温度との差を冷却開始から 最終的な冷却温度に達するまでの時間で割った値であ

【0047】さらに、これを0~200℃ (好ましくは 0~150℃、さらに好ましくは0~120℃、最も好 ましくは0~50℃)に加温すると、有機溶媒中にセル ロースアセテートが溶解する、昇温は、室温中に放置す るだけでもよいし、温浴中で加温してもよい。加温速度 は、4℃/分以上であることが好ましく、8℃/分以上 であることがさらに好ましく、12℃/分以上であるこ とが最も好ましい。加温速度は、速いほど好ましいが、 10000℃/秒が理論的な上限であり、1000℃/ 秒が技術的な上限であり、そして100℃/秒が実用的 な上限である。なお、加温速度は、加温を開始する時の 温度と最終的な加温温度との差を加温を開始してから最 終的な加温温度に達するまでの時間で割った値である。 以上のようにして、均一な溶液が得られる。なお、溶解 30 が不充分である場合は冷却、加温の操作を繰り返しても よい。溶解が充分であるかどうかは、目視により溶液の 外観を観察するだけで判断することができる。

【0048】冷却溶解法においては、冷却時の結蹊によ る水分混入を避けるため、密閉容器を用いることが望ま しい。また、冷却加温操作において、冷却時に加圧し、 加温時の減圧すると、溶解時間を短縮することができ る。加圧および減圧を実施するためには、耐圧性容器を 用いることが望ましい。なお、セルロースアセテート (酢化度:60.9%、粘度平均重合度:299)を冷 40 却溶解法によりメチルアセテート中に溶解した20質量 %の溶液は、示差走査熱量測定 (DSC) によると、3 3℃近傍にゾル状態とゲル状態との疑似相転移点が存在 し、この温度以下では均一なゲル状態となる。従って、 この溶液は疑似相転移温度以上、好ましくはゲル相転移 温度プラス10℃程度の温度で保する必要がある。 ただ し、この疑似相転移温度は、セルロースアセテートの酢 化度、粘度平均重合度、溶液温度や使用する有機溶媒に より異なる。

プ) から、ソルベントキャスト法によりセルロースアセ テートフィルムを製造する。ドープは、ドラムまたはバ ンド上に流延し、溶媒を蒸発させてフィルムを形成す る。流延前のドープは、固形分量が18~35%となる ように濃度を調整することが好ましい。ドラムまたはバ ンドの表面は、鏡面状態に仕上げておくことが好まし い、ソルベントキャスト法における流延および乾燥方法 については、米国特許2336310号、同23676 03号、同2492078号、同2492977号、同 であることが最も好ましい。冷却速度は、速いほど好ま 10 2492978号、同2607704号、同27390 69号、同2739070号、英国特許640731 号、同736892号の各明細書、特公昭45-455 4号、同49-5614号、特開昭60-176834 号、同60-203430号、同62-115035号 の各公報に記載がある。ドープは、表面温度が10℃以 下のドラムまたはバンド上に流延することが好ましい。 流延してから2秒以上風に当てて乾燥することが好まし い。得られたフィルムをドラムまたはパンドから剥ぎ取 り、さらに100から160℃まで逐次温度を変えた高 20 温風で乾燥して残留溶剤を蒸発させることもできる。以 上の方法は、特公平5-17844号公報に記載があ る。この方法によると、流延から弱ぎ取りまでの時間を 短縮することが可能である。この方法を実施するために は、流延時のドラムまたはバンドの表面温度においてド ープがゲル化することが必要である。

16

【0050】調製したセルロースアセテート溶液(ドー プ)を用いて2層以上の流延でフィルム化することもで きる。この場合、ソルベントキャスト法によりセルロー スアシレートフィルムを作製することが好ましい。ドー プは、ドラムまたはバンド上に流延し、溶媒を蒸発させ てフィルムを形成する。流延前のドープは、固形分量が 10~40%となるように濃度を調整することが好まし い。ドラムまたはパンドの表面は、鏡面状態に仕上げて おくことが好ましい。

【0051】2層以上の複数のセルロースアセテート液 を流延する場合、複数のセルロースアセテート溶液を流 延することが可能で、支持体の進行方向に間隔を置いて 設けた複数の流延口からセルロースアセテートを含む溶 液をそれぞれ流延させて積層させながらフィルムを作製 してもよく、例えば特開昭61-158414号、特開 平1-122419号、特開平11-198285号な どの公報に記載の方法が適用できる。また、2つの流延 口からセルロースアセテート溶液を流延することによっ てもフィルム化することでもよく、例えば特公昭60-27562号、特開昭61-94724号、特開昭61 -947245号、特開昭61-104813号、特開 昭61-158413号、特開平6-134933号、 に記載の方法で実施できる。また、特開昭56-162 617号に記載の高粘度セルロースアセテート溶液の流 【0049】調製したセルロースアセテート溶液(ドー 50 れを低粘度のセルロースアセテート溶液で包み込み、そ

(10)

特開2003-156605

17

の高、低粘度のセルロースアセテート溶液を同時に押出 すセルロースアセテートフィルム流延方法でもよい。 【0052】或いはまた2個の流延口を用いて、第一の 流延口により支持体に成型したフィルムを剥ぎ取り、支 持体面に接していた側に第二の流延を行なうことでよ り、フィルムを作製することでもよく、例えば特公昭4 4-20235号に記載されている方法である。流延す るセルロースアセテート溶液は同一の溶液でもよいし、 異なるセルロースアセテート溶液でもよく特に限定され ない。複数のセルロースアセテート層に機能を持たせる 10 ために、その機能に応じたセルロースアセテート溶液 を、それぞれの流延口から押出せばよい。さらにセルロ ースアセテート溶液は、他の機能層(例えば、接着層、 染料層、帯電防止層、アンチハレーション層、UV吸収 層、偏光層など)を同時に流延することも実施しうる。 【0053】従来の単層液では、必要なフィルム厚さに するためには高濃度で高粘度のセルロースアセテート溶 液を押出すことが必要であり、その場合セルロースアセ テート溶液の安定性が悪くて固形物が発生し、ブツ故障 となったり、平面性が不良であったりして問題となるこ 20 とが多かった。この解決として、複数のセルロースアセ テート溶液を流延口から流延することにより、高粘度の 溶液を同時に支持体上に押出すことができ、平面性も良 化し優れた面状のフィルムが作製できるばかりでなく、 濃厚なセルロースアセテート溶液を用いることで乾燥負 荷の低減化が達成でき、フィルムの生産スピードを高め ることができる.

【0054】セルロースアセテートフィルムには、機械 的物性を改良するため、または乾燥速度を向上するため に、可塑剤を添加することができる。可塑剤としては、 リン酸エステルまたはカルボン酸エステルが用いられ る。リン酸エステルの例には、トリフェニルフォスフェ ート (TPP) およびトリクレジルホスフェート (TC P) が含まれる。カルボン酸エステルとしては、フタル 酸エステルおよびクエン酸エステルが代表的である。フ タル酸エステルの例には、ジメチルフタレート(DM P)、ジエチルフタレート(DEP)、ジブチルフタレ ート(DBP)、ジオクチルフタレート(DOP)、ジ フェニルフタレート (DPP) およびジエチルヘキシル フタレート (DEHP) が含まれる。 クエン酸エステル 40 の例には、O-アセチルクエン酸トリエチル(OACT E) およびO-アセチルクエン酸トリブチル (OACT B) が含まれる。その他のカルボン酸エステルの例に は、オレイン酸ブチル、リシノール酸メチルアセチル、 セバシン酸ジブチル、種々のトリメリット酸エステルが 含まれる。フタル酸エステル系可塑剤 (DMP、DE P、DBP、DOP、DPP、DEHP)が好ましく用 いられる。DEPおよびDPPが特に好ましい。可塑剤 の添加量は、セルロースエステルの量の0.1~25質 量%であることが好ましく、1~20質量%であること 50 は、フィルムのガラス転移温度以下であることが好まし

がさらに好ましく、3~15質量%であることが最も好 ましい。

【0055】セルロースアセテートフィルムには、劣化 防止剤(例、酸化防止剤、過酸化物分解剤、ラジカル禁 止剤、金属不活性化剤、酸捕獲剤、アミン)を添加して・ もよい。劣化防止剤については、特開平3-19920 1号、同5-1907073号、同5-194789 号、同5~271471号、同6-107854号の各 公報に記載がある。劣化防止剤の添加量は、調製する溶 液 (ドープ) の0.01~1質量%であることが好まし く、0.01~0.2質量%であることがさらに好まし い。添加量が0.01質量%未満であると、劣化防止剤 の効果がほとんど認められない。添加量が質量%を越え ると、フィルム表面への劣化防止剤のブリードアウト (海み出し)が認められる場合がある。特に好ましい劣 化防止剤の例としては、ブチル化ヒドロキシトルエン (BHT)、トリベンジルアミン(TBA)を挙げるこ とができる。

【0056】セルロースアセテートフィルムの熱伝導性 を向上させるために様々な高熱伝導性粒子を使用するこ とができる。高熱伝導性粒子としては、窒化アルミニウ ム、窒化ケイ素、窒化ホウ素、窒化マグネシウム、炭化 ケイ素、酸化アルミニウム、酸化ケイ素、酸化亜鉛、酸 化マグネシウム、炭素、ダイヤモンド、金属等を挙げる ことができる。フィルムの透明性を損なわないために、 透明な粒子を使用することが望ましい。高熱伝導性粒子 のセルロースアセテートフィルムへの配合量は、セルロ ースアセテート100質量部に対して5~100質量部 の範囲で充填するのがよい。配合量が5質量部未満であ ると熱伝導の向上が乏しく、また100質量部を超える 充填は、生産性の面で困難かつセルロースアセテートフ ィルムが脆いものになってしまう。高熱伝導性粒子の平 均粒径は0.05~80µm、好ましくは0.1~10 μmが好ましい。球状の粒子を用いてもよいし、針状の 粒子を用いてもよい。

【0057】セルロースアセテートフィルムは、吸湿筋 張を低減させるために、延伸処理されることが好まし い、延伸することにより、延伸方向の吸湿膨張が低減で きるので、面内すべての方向で歪みを低減するために二 軸延伸することが更に好ましい。二軸延伸には、同時二 軸延伸法と逐次二軸延伸法があるが、連続製造の観点か ら逐次二軸延伸方法が好ましく、ドープを流延した後、 バンドもしくはドラムより剝ぎ取り、幅方向(長手方) 法) に延伸した後、長手方向(幅方向)に延伸される。 【0058】幅方向に延伸する方法は、例えば、特開昭 62-115035号、特開平4-152125号、同 4-284211号、関4-298310号、同11-48271号などの各公報に記載されている。フィルム の延伸は、常温または加熱条件下で実施する。加熱温度

特開2003-156605

い。フィルムは、乾燥中の処理で延伸することができ、 特に溶媒が残存する場合は有効である。長手方向の延伸 の場合、例えば、フィルムの搬送ローラーの速度を調節 して、フィルムの剥ぎ取り速度よりもフィルムの巻き取 り速度の方を速くするとフィルムは延伸される。幅方向 の延伸の場合、フィルムの巾をテンターで保持しながら 搬送して、テンターの巾を徐々に広げることによっても フィルムを延伸できる。フィルムの乾燥後に、延伸機を 用いて延伸すること(好ましくはロング延伸機を用いる 対する延伸による増加分の比率)は、5~50%が好ま しく、さらに好ましくは10~40%、最も好ましくは 15~35%である。

19

【0059】これら流延から後乾燥までの工程は、空気 雰囲気下でもよいし窒素ガスなどの不活性ガス雰囲気下 でもよい。本発明のセルロースアセテートフィルムの製 造に係わる巻き取り機は一般的に使用されているもので よく、定テンション法、定トルク法、テーパーテンショ ン法、内部応力一定のプログラムテンションコントロー ル法などの巻き取り方法で巻き取ることができる。

【0060】吸湿膨張係数の測定方法について以下に示 す。作製したポリマーフィルムから幅5mm、長さ20 mmの試料を切り出し、片方の端を固定して25度、2 0%RHの雰囲気下によら下げた。他方の端に0.5g の重りをぶら下げて、一定時間放置した。次に、一定温 度のまま、湿度を80%RHにして、長さの変形量を測 定した。測定は同一試料につき10サンプル行い、平均 値を採用した。上記吸湿による寸度変化は、ボリマーフ ィルム中の自由体積を小さくすればよいことを見出し た。該自由体積を大きく左右するのは、製膜時の残留溶 30 ルギーを算出できる。 剤量であり、少ない方が寸度変化は少ない。 残留溶剤を 減らすための一般的手法は、高温かつ長時間で乾燥する ことであるが、あまり長時間であると、当然のことなが ら生産性が落ちるため、0.01~1質量%であること が好ましく、0.02~0.07質量%が更に好まし く、最も好ましいのは、0.03~0.05質量%であ る。上記残留溶剤量を制御することにより、光学補償能 を有する偏光板を安価に高い生産性で製造することが可 能となる。また、上記吸湿による寸度変化を小さくする 方法として、疎水性を有する化合物を添加することが好 ましい。疎水性を有する素材としては、分子中にアルキ ル基やフェニル基のような疎水基を有する素材であれば 特に制限はないが、後述の可塑剤や劣化防止剤の中で該 当する素材が特に好ましく用いられる。添加量は調整す る溶液 (ドープ) の0.01~10質量%が好ましく、 ○○1~5質量%がさらに好ましく、1~3質量%が最 も好ましい。

【0061】セルロースアセテートフィルムは、表面処 理を施すことが好ましい。具体的方法としては、コロナ

20 リ処理または紫外線照射処理が挙げられる。また、特開 平7-333433号公報に記載のように、下塗り層を 設けることも好ましく利用される。フィルムの平面性を 保持する観点から、これら処理においてセルロースアセ テートフィルムの温度をTg以下、具体的には150度 以下とすることが好ましい。偏光板の透明保護膜として 使用する場合、偏光膜との接着性の観点から、酸処理ま たはアルカリ処理、すなわちセルロースアセテートに対 するケン化処理を実施することが特に好ましい。 表面工 一軸延伸) もできる、フィルムの延伸倍率(元の長さに 10 ネルギーは55mN/m以上であることが好ましく、6 OmN/m以上75mN/m以下であることが更に好ま しい。以下、アルカリ酸化処理を例に、具体的に説明す る。フィルム表面をアルカリ溶液に浸漬した後、酸性溶 液で中和し、水洗して乾燥するサイクルで行われること が好ましい。アルカリ溶液としては、水酸化カリウム溶 液、水酸化ナトリウム溶液が挙げられ、水酸化イオンの 規定濃度はO.1N~3. ONであることが好ましく、 O. 5N~2. ONであることがさらに好ましい。アル カリ溶液温度は、室温~90度の範囲が好ましく、40 20 度~70度がさらに好ましい。固体の表面エネルギー は、「ぬれの基礎と応用」(リアライズ社 1989. 12.10発行) に記載のように接触角法、湿潤熱法、 および吸着法により求めることができる。本発明のセル ロースアセテートフィルムの場合、接触角法を用いるこ とが好ましい。具体的には、表面エネルギーが既知であ る2種の溶液をセルロースアセテートフィルムに満下 し、液満の表面とフィルム表面との交点において、液滴 に引いた接線とフィルム表面のなす角で、液滴を含む方 の角を接触角と定義し、計算によりフィルムの表面エネ

> 【0062】 (偏光子)次に、本発明の偏光板を構成す る偏光子について説明する。偏光子としては、ヨウ素系 **偏光膜、二色性染料を用いる染料系偏光膜やポリエン系 優光膜が挙げられる。ヨウ素系偏光膜および染料系偏光** 膜は、一般にポリビニルアルコール系フィルムを用いて 製造することができる。

【0063】 [偏光板を構成するその他の層] 偏光板の **偏光子には、その両側に二枚の透明保護膜を配置するこ** とができる。これらの保護膜の内、一つは光学異方性層 40 との間に存在する透明基材フィルム7として好ましく用 いられる上記したセルロースアセテートフィルムを兼ね ることができ、他方の保護膜は光散乱層との間に存在す る透明基材フィルム2として好ましく用いられるセルロ ースアセテートフィルムを兼わることができる. 保護膜 であるセルロースアセテートフィルムの遅相軸と偏光子。 の透過軸とは、実質的に平行になるように配置する。偏 光板の生産性には保護フィルムの透湿性が重要である。 **偏光子と保護フィルムは水系接着剤で貼り合わせられて** おり、この接着剤溶剤は保護フィルムのなかを拡散する 放電処理、グロー放電処理、火炎処理、酸処理、アルカ 50 ことで乾燥されるからである。保護フィルムの透湿性が

21

高ければ、高いほど乾燥は早くなり、生産性は向上する が、高くなりすぎると、液晶表示装置の使用環境(高温 下)により、水分が偏光膜中に入ることで偏光能が低下 する。保護フィルムの透湿性は、ポリマーフィルム(お よび重合性液晶化合物)の厚み、自由体積、親疎水性等 により決定される。偏光板の保護フィルムの透湿性は、 100~1000g/m<sup>2</sup>·24hrsであることが好 ましく、300~700g/m2·24hrsであるこ とが更に好ましい。保護フィルムの厚みは、製膜の場 合、リップ流量とラインスピード、あるいは、延伸、圧 10 縮により調整することができる。使用する主素材により 透湿性が異なるので、厚み調整により好ましい範囲にす ることが可能である。保護フィルムの自由体積は、製膜 の場合、乾燥温度と時間により調整することができる。 この場合もまた、使用する主衆材により透湿性が異なる ので、自由体積調整により好ましい範囲にすることが可 能である。保護フィルムの親疎水性は、添加剤により調 整することができる。上記自由体積中に親水的添加剤を 添加することで透湿性は高くなり、逆に疎水性添加剤を 添加することで透湿性を低くすることができる。 【0064】〔液晶表示装置〕本発明の偏光板は、液晶 表示装置、特に透過型液晶表示装置に有利に用いられ る、透過型液晶表示装置は、液晶セルおよびその両側に 配置された二枚の偏光板からなる。液晶セルは、二枚の 電極基板の間に液晶を担持している。本発明の爛光板は その光学異方性層を液晶セル面側に配置して使用するこ とが好ましい。液晶セルには種々のモードが存在する。 STNモードの液晶セルでは、電圧無印加時に棒状液晶 性分子が実質的に水平配向し、さらに180~~270 \*にねじれ配向している。また、TNモードの液晶セル では、電圧無印加時に棒状液晶性分子が実質的に水平配 向し、さらに60~120°にねじれ配向している。S TNモード、およびTNモードの液晶セルは、黒白、お よびカラー液晶表示装置として最も多く利用されてお り、多数の文献に記載がある。VAモードの液晶セルで は、電圧無印加時に棒状液晶性分子が実質的に垂直に配 向している。VAモードの液晶セルには、(1)棒状液 晶性分子を電圧無印加時に実質的に垂直に配向させ、電 圧印加時に実質的に水平に配向させる狭義のVAモード の液晶セル (特開平2-176625号公報記載) に加 40 えて、(2) 視野角拡大のため、VAモードをマルチド メイン化した (MVAモードの) 液晶セル (SID9 7、Digest of tech. Papers (予稿集) 28 (199 7)845記載〉、(3)棒状液晶性分子を電圧無印加 時に実質的に垂直配向させ、電圧印加時にねじれマルチ ドメイン配向させるモード(n-ASMモード)の液晶 セル(日本液晶討論会の予稿集58~59(1998) 記載) および(4) SURVAI VALモードの液晶セ ル (LCDインターナショナル98で発表) が含まれ

る。OCBモードの液晶セルは、棒状液晶性分子を液晶

セルの上部と下部とで実質的に逆の方向に(対称的に)配向させるベンド配向モードの液晶セルを用いた液晶表示装置であり、米国特許4583825号、同5410422号の各明細審に開示されている。棒状液晶性分子が液晶セルの上部と下部とで対称的に配向しているため、ベンド配向モードの液晶セルは、自己光学補償機能を有する。そのため、この液晶モードは、OCB(Optically Compensatory Bend)液晶モードとも呼ばれる。ベンド配向モードの液晶表示装置は、応答速度が速いとの利点がある。

22

[0065]

した。

【実施例】以下、実施例に基づき本発明を具体的に説明 するが、本発明は実施例に限定されない。

【0066】(光散乱フイルムHKF-01の作製)光 散乱層を構成する透光性樹脂バインダーは、開始剤含有 シリカ分散ハードコート液(デソライトスー7526、 JSR (株) 製) を44質量部、ジペンタエリスリトー ルヘキサ(メタ)アクリレート(日本化薬社製、KAY ARAD DPHA)を3質量部、これらをエアディス パで攪拌しながらメチルイソブチルケトン39質量部に 添加、溶解した、この液を塗布、紫外線硬化して得られ た塗膜の屈折率は1.51であった。この溶液に透光性 徴粒子として、架橋スチレンビーズ(コールタール法で の数平均粒径1.3μm、屈折率1.61)を11質量 ・部、架橋スチレンビーズ(コールタール法での数平均粒 径3.5 μm、粒径の標準偏差は0.56で粒径の16 %、屈折率1.61)を2.5質量部、添加、混合して 調整したもの(6.5 µm以上の租大粒子を含有する割 合は2個/1×108個) を、トリアセチルセルロース フィルム(富士写真フイルム社製、TD-80U)上 に、乾燥膜厚3.5µmになるように塗工、溶剤乾燥 後、160W/cmの空冷メタルハライドランプ (アイ グラフィックス(株)製)を用いて、照度400mW/ cm<sup>2</sup>、照射量300mJ/cm<sup>2</sup>の紫外線を照射して塗 布層を硬化させ光散乱フィルム(HKF-01)を作製

【0067】HKF-01のヘイズ(桑価)を測定したところ、全ヘイズ値65%であり適度なヘイズとなった。また、表面凹凸を除くようにして内部ヘイズを評価したところ52%であった。なお表面粗さRaは0.22μmであった。

【0068】(光散乱フイルムHKF-02の作製)光散乱層を構成する透光性樹脂バインダーは、開始剤含有酸化ジルコニウム分散ハードコート液(デソライトKZ-7114A、JSR(株)製)を39質量部、ジペンタエリスリトールへキサ(メタ)アクリレート(日本化薬社製、KAYARAD DPHA)を18質量部、これらをエアディスパで撹拌しながらメチルエチルケトン11質量部、メチルイソブチルケトン24質量部の混合液に添加溶解した。この液を塗布、紫外線硬化して得ら

(13)

特開2003-156605

24

れた途膜の屈折率は1.61であった。この溶液に透光 性徴粒子として、PMMA(ポリメチルメタクリレー ト) ビーズ (コールタール法数平均粒径1.5 μm、屈 折率1.49)を5.5質量部、およびPMMA(ポリ メチルメタクリレート)ビーズ(コールタール法数平均 粒径3.0μm、屈折率1.49、粒径の標準偏差0. 75 (粒径の25%)、屈折率1.49)を3.5質量 部、これらを混合して調整したもの(6.0μm以上の 粗大粒子を含有する割合は1個/1×108個)を、ト リアセチルセルロースフィルム(富士写真フイルム社 製、TD-80U)上に、乾燥膜厚4. 0μmになるよ うに建工、溶剤乾燥後、160W/cmの空冷メタルハ ライドランプ (アイグラフィックス (株) 製) を用い て、照度400mW/cm2、照射量300mJ/cm2 の紫外線を照射して塗布層を硬化させ光散乱フィルム (HKF-02)を作製した。

【0069】HKF-02のヘイズ (曇価) を測定した ところ、全ヘイズ値53%であり適度なヘイズとなっ た。また、表面凹凸を除くようにして内部へイズを評価 mであった。

【0070】(光散乱フイルムHKF-03の作製)光 散乱層を構成する透光性樹脂バインダーは、開始剤含有 シリカ分散ハードコート液(デソライトスー7526、 JSR (株) 製) を44質量部、ジベンタエリスリトー ルヘキサ (メタ) アクリレート (日本化薬社製、ΚΑΥ ARADDPHA)を3質量部、これらをエアディスパ で撹拌しながらメチルイソブチルケトン39質量部に添 加、溶解した。この液を塗布、紫外線硬化して得られた 粒子として、架橋スチレンビーズ(コールタール法数平 均粒径1. 3μm、屈折率1. 61)を17質量部、架 橋スチレンビーズ (コールタール法数平均粒径3.8μ m、粒径の標準偏差0.95(粒径の25%)、屈折率 1.61)を3質量部、添加、混合して調整したもの (6.8μm以上の粗大粒子を含有する割合は4個/1 ×108個) を、トリアセチルセルロースフィルム (富 士写真フイルム社製、TD-80U)上に、乾燥膜厚 4.0 μmになるように塗工、溶剤乾燥後、160W/ cmの空冷メタルハライドランプ (アイグラフィックス 40 (株) 製)を用いて、照度400mW/cm²、照射量 300mJ/cm²の紫外線を照射して塗布層を硬化さ せ光散乱フィルム (HKF-03)を作製した。

【0071】HKF-03のヘイズ (曇何) を測定した ところ、全ヘイズ値75%であり適度なヘイズとなっ た。また、表面凹凸を除くようにして内部へイズを評価 したところ68%であった。なお、表面粗さは0.96 μmであった。

【0072】(光散乱フイルムHKF-H1の作製)光 散乱層を構成する透光性樹脂バインダーは、開始剤含有 50

酸化ジルコニウム分散ハードコート液(デソライトKZ -7114A、JSR (株) 製) を39質量部、ジペン タエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート (日本化 菜社製、KAYARAD DPHA)を18質量部、こ れらをエアディスパで撹拌しながらメチルエチルケトン 11質量部、メチルイソブチルケトン24質量部の混合 液に添加溶解した。この液を塗布、紫外線硬化して得ら れた塗膜の屈折率は1.61であった。この溶液に透光 性微粒子として、PMMA(ポリメチルメタクリレー 10 ト)ビーズ (コールタール法数平均粒径1.0μm、屈 折率1.49)を21質量部、およびPMMA(ポリメ チルメタクリレート) ビーズ (コールタール法数平均粒 径1.9μm、屈折率1.49、粒径の標準偏差0.5 7 (粒径の30%)、屈折率1.49)を9質量部、こ れらを混合して調整したもの(4.9μm以上の粗大粒 子を含有する割合は215個/1×108個)を、トリ アセチルセルロースフィルム(富士写真フイルム社製、 TD-80U)上に、乾燥膜厚4、0μmになるように 塗工、溶剤乾燥後、160W/cmの空冷メタルハライ したところ36%であった。なお表面祖さはO.10x 20 ドランプ (アイグラフィックス (株) 製)を用いて、照 度400mW/cm<sup>2</sup>、照射量300mJ/cm<sup>2</sup>の紫外 線を照射して塗布層を硬化させ光散乱フィルム(HKF - H1)を作製した.

【0073】村上色彩技術研究所製HR-100を用い て、HKF-H1のヘイズ(罍価)を測定したところ、 28%であった。また、表面凹凸を除くようにして内部 ヘイズを評価したところ14%であった。なお、表面粗 さは0.01μmであった。

【0074】 (光散乱フイルムHKF-02の作製) 光 塗膜の屈折率は1.51であった。この溶液に透光性微 30 散乱層を構成する透光性樹脂パインダーは、開始剤含有 シリカ分散ハードコート液 (デソライト2~7526、 JSR (株) 製) を44質量部、ジペンタエリスリトー ルヘキサ (メタ) アクリレート (日本化薬社製、KAY ARAD DPHA)を3質量部、これらをエアディス パで攪拌しながらメチルイソブチルケトン39質量部に 添加、溶解した。この液を塗布、紫外線硬化して得られ た塗膜の屈折率は1.51であった。この溶液に透光性 做粒子として、スチレンビーズ(コールタール法数平均 粒径1.7μm、屈折率1.60)を17質量部、スチ レンピーズ (コールタール法数平均粒径3.9μm、粒 径の標準偏差1.17 (粒径の30%)、屈折率1.6 0)を8質量部、添加、混合して調整したもの(6.9 μm以上の租大粒子を含有する割合は1034個/1× 108個) を、トリアセチルセルロースフィルム (富士 写真フイルム社製、TD-80U)上に、乾燥膜厚5. Oμmになるように塗工、溶剤乾燥後、160W/cm の空冷メタルハライドランプ (アイグラフィックス (株)製)を用いて、照度400mW/cm2、照射量 300mJ/cm²の紫外線を照射して塗布層を硬化さ せ光散乱フィルム (HKF-H2)を作製した。

(14)

特開2003-156605

25

【0075】 HKF-H2のヘイズ (盝価)を測定した ところ、全ヘイズ値93%であった。また、表面凹凸を 除くようにして内部ヘイズを評価したところ82%であ った。なお、表面祖さはO. 16 μmであった。

【0076】(セルロースアセテート溶液の調製)下記\*

セルロースアセテート溶液組成

100質量部 ・酢化度60.9%のセルロースアセテート 7.8質量部 トリフェニルホスフェート(可塑剤) 3.9質量部 ビフェニルジフェニルホスフェート(可塑剤) 300質量部 メチレンクロライド(第1溶媒) 54 質量部 ・メタノール(第2溶媒)

製した。

[0077]

・1-ブタノール(第3溶媒)

※01) について、エリプソメーター(M-150、日本 分光(株)製)を用いて、波長633nmにおけるRe レターデーション値およびRthレターデーション値を 測定した。Reは10nmで、Rthは81nmであっ

11質量部

\*の成分をミキシングタンクに投入し、加熱しながら撹拌

して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調

ール20質量部を投入し、加熱しながら撹拌して、レタ ーデーション上昇剤溶液を調製した。セルロースアセテ ート溶液475質量部に上記レターデーション上昇剤溶 液25質量部を混合し、充分に撹拌してドープを調製し た、レターデーション上昇剤の添加量は、セルロースア セテート100質量部に対して、3.0質量部であっ た。作製したセルロースアセテートフィルム(CAF-※

【0078】別のミキシングタンクに、レターデーショ ン上昇剤(スミソルプTM165-F 住友化学製)1

6質量部、メチレンクロライド80質量部およびメタノ

【0079】(セルロースアセテート溶液の調製)下記 の成分をミキシングタンクに投入し、加熱しながら撹拌 して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調 製した。

・セルローストリアセテート(置換度2.82、粘度平均重合度320、含水率 O. 4質量%、メチレンクロライド溶液中6質量%の粘度 305mPa·s、 平均粒子径1.5mmであって領準偏差0.5mmである粉体)

・酢酸メチル ・アセトン ・メタノール ・エタノール ・ブタノール

58質量部 5質量部 5 質量部

20衛量部

5質量部 5 質量部

・可塑剤A (ジトリメチロールプロパンテトラアセテート)

・可塑剤B(トリフェニルフォスフェート)

1.2質量部 1.2質量部

·UV剤a:(2.4-ビス-(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシー 3.5-ジーtert-ブチルアニリノ)-1.3.5-トリアジン

0.2質量部

・UV剤b :2(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジーtert-ブチルフェ 0.2質量部 ニル) -5-クロルベンゾトリアゾール

·UV剤c(2(2'ーヒドロキシー3', 5'ージーtertーアミルフェニ

ル) -5-クロルベンゾトリアゾール - C12 H25 OC H2 C H2 O - P (= O) - (OK) 2 (剝離剤)

0.02質量部

0.2質量部

0.02質量部

・クエン酸(剥離剤) ・、散粒子(シリカ(粒径20nm)、モース硬度 約7)

0.05質量部

【0080】なお、ここで使用したセルローストリアセ テートは、残存酢酸量がO. 01質量%以下であり、C aが0.05質量%、Mgは0.007質量%であり、 さらにFeは5ppmであった。また6位アセチル基は 0.95であり全アセチル中の32.2%であった。ま た、アセトン抽出分は11質量%、質量平均分子量と数★50 ン上昇剤(スミソルブTM165-F 住友化学製)1

★平均分子量の比は0.5であり、分布の均一なものであ った。また、イエローネスインデックスは0.3であ り、ヘイズはO.08、透明度は93.5%であり、T gは160℃、結晶化発熱量は6.2J/gであった。 【0081】別のミキシングタンクに、レターデーショ (15)

特開2003-156605

28

6質量部、メチレンクロライド80質量部およびメタノ ール20質量部を投入し、加熱しながら撹拌して、レタ ーデーション上昇剤溶液を調製した。セルロースアセテ ート溶液475質量部に上記レターデーション上昇利溶 液25質量部を混合し、充分に撹拌してドープを調製し た。レターデーション上昇剤の添加量は、セルロースア セテート100質量部に対して、3.0質量部であっ た。作製したセルロースアセテートフィルム(CAFー

27

02) について、エリプソメーター(M-150、日本\*

・ゼラチン

・ホルムアルデヒド

・サリチル酸

・アセトン

- メタノール

・メチレンクロライド

• 水

\* 分光 (株) 製) を用いて、波長633nmにおけるRe レターデーション値およびRthレターデーション値を 測定した。Reは10nmで、Rthは81nmであっ た.

【0082】(下途り層の作製)前記で作製したセルロ ースアセテートフィルム (CAF-01) に下記組成の 塗布液を28 c c / m²塗布乾燥し、0. 1 μ m の下塗 り層を塗設した。

0.542質量部

0.136質量部

0.160質量部

39.1質量部

15.8質量部

40.6質量部

1.2質量部

【0083】さらにその上に下記組成の塗布液を7cc※ ※/m2塗布乾燥した。

·アニオン性下記共重合体(x:y:z=50/25/25質量比)

0.079質量部

1.01質量部 20質量部

87. 7質量部

4.05質量部

クエン酸モノエチルエステル ・アセトン

・メタノール

· 水

★【0085】さらに上記と反対側の層に下記組成の塗布 液を25cc/m2塗布乾燥し、バック層を設けた。 [0086]

[0084] (化1) -<del>(</del>çн-çн<del>),</del> <del>-{çн-çн},</del> -{СН₂--ÇН<del>};</del>ço ço င့်ဝ ငှံဝ он о-сн₂ он он 2Na **★**30

バック層塗布液組成物

- セルロースジアセテート (酢化度55%)

- シリカ系マット剤(平均粒径 l μm)

・アセトン

・メタノール

0.656質量部

0.065質量部

67.9質量部

10.4質量部

【0087】(配向膜層の作製)このセルロースアセテ ートフィルム (CAF-01) のゼラチン暦上に、下記 の組成の塗布液を#16のワイヤーバーコーターで28 m 1/m2塗布した。60℃の温風で60秒、さらに9 ☆

☆0℃の温風で150秒乾燥した。次に、セルロースアセ テートフィルム (САF-01) の長手方向に、形成し た膜にラビング処理を実施した。

· [0088]

配向膜塗布液組成 下記構造の変性ポリビニルアルコール

· P V A 2 1 7 (クラレ製)

371質量部

·ĸ

8質量部

2質量部

・メタノール

119質量部

グルタルアルデヒド(架橋剤)

0.5質量部

[0089]

(CH2)4-O-CO-CH=CH2

構造のディスコティック液晶性化合物41.01g、エ チレンオキサイド変成トリメチロールプロパントリアク リレート (V#360、大阪有機化学(株)製)2.0 38、ジベンタエリストールヘキサ (メタ) アクリレー ト (KYARAD DPHA 日本化薬製) 2.03 g、セルロースアセテートブチレート(CAB551-0.2、イーストマンケミカル社製) 0.90g、セル ロースアセテートブチレート (CAB531-1、イー ストマンケミカル社製) 0.23g、光重合開始剤(イ ルガキュアー907、チバガイギー社製)1.35g、 増感剤(カヤキュアーDETX、日本化薬(株)製) 0.45gを、102gのメチルエチルケトンに溶解し\*

【0090】(光学異方性層の形成)配向膜上に、下記 10\*た塗布液を、#4のワイヤーバーで塗布した。これを金 属の枠に貼り付けて、130℃の恒温槽中で2分間加熱 し、上記ディスコティック液晶性化合物を配向させた。 次に、80℃の雰囲気下のもと、膜面温度が約100℃ の状態で120W/cm高圧水銀灯を用いて、0.4秒 間UV照射しディスコティック液晶性化合物を重合させ た。その後、室温まで放冷した。このようにして、光学 異方性層を形成した。波長633mmで測定した光学異 方性層のReレターデーション値は48 nmであった。 また、ディスコティック化合物の円盤面と第1透明支持 体面との間の角度(傾斜角)は平均で42°であった。 [0091]

【化3】

ディスコティック液晶性化合物

【0092】次に、上記フィルムを用いて優光板を作成 し、液晶表示装置での評価を実施した。

【0093】 <視認側隔光板 SHB-01の作製>延 伸したポリピニルアルコールフイルムにヨウ素を吸着さ せて偏光膜を作製した。HKF-01に飲化処理を行 い、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、HKF-01の透明基材フィルム (トリアセチルセルロース)が 偏光膜側となるように偏光膜の片側に貼り付けた。ま た、上記で作成した液晶性化合物からなる光学異方性層 を有するセルロースアセテートフィルムを1.5Nの水 酸化カリウム/ (水/IPA/PG=14/86/15 容量%)溶液を用いて両面ケン化処理し、その後、ポリ ビニルアルコール系接着剤を用いて、上記セルロースア セテートフィルムが偏光膜側となるように反対側に貼り 付けた。このようにして視認側偏光板(SHB-01) を作製した。偏光膜の透過軸と前記で作製した光学異方 性層の遅相軸とは平行になるように配置した。偏光膜の 透過軸と前記透明基材フィルムの遅相軸とは、直交する※50

※ように配置した。

【0094】<視認例偏光板 SHB-02、03の作 製>HKF-01と同様にしてHKF-02とHKF-0 3から視認関偏光板(SHB-02、SHB-03) を作製した。

【0095】 <視認側偏光板 SHB-H1、H2の作 製>HKF-01と同様にしてHKF-H1とHKF-40 H2から視認側偏光板 (SHB-H1、SHB-H2) を作製した。

【0096】 <バックライト側隔光板 BHB-01の 作製>延伸したポリビニルアルコールフイルムにヨウ素 を吸着させて佴光膜を作製した。市販のトリアセチルセ ルロースフィルム(富士写真フイルム製 フジタックT D80) に酸化処理を行い、ポリビニルアルコール系接 着剤を用いて、偏光膜の片側に貼り付けた。また、透明 フィルム支持体上に液晶性化合物からなる光学異方性層 を有する光学補償フィルムWVSA12B(富士写真フ ィルム製)にケン化処理を行い、ポリビニルアルコール

(17)

特開2003-156605

32

系接着剤を用いて、WVSA12Bの透明フィルム支持体が偏光膜側となるように反対側に貼り付けた。このようにしてバックライト側偏光板(BHB-01)を作製した。

31

[0097] (実施例1] TN型液晶セルを使用した液晶表示装置(6E-A3、シャープ(株)製)に設けられている一対の偏光板を剥がし、代わりに偏光板(SHB-01)を、光学補償フィルムが液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側に貼り付けた。またバックライト側には、光学異方性層側が液晶セル側となるように粘着剤を介してバックライト側偏光板(BHB-01)を貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸と、バックライト側の偏光板の透過軸とは、Oモードとなるように配置した。

[0098] [実施例2] SHB-01に代えてSHB-02を使う以外は実施例1と同様にして液晶表示装置を作製した。

【0099】[実施例3] SHB-01に代えてSHB-03を使う以外は実施例1と同様にして液晶表示装置を作製した。

【0100】[比較例1] SHB-01に代えてSHB-H1を使う以外は実施例1と同様にして液晶表示装置を作製した。

【0101】[比較例2] SHB-01に代えてSHB-H2を使う以外は実施例1と同様にして液晶表示装置を作製した。

【0102】【比較例3】TN型液晶セルを使用した液晶表示装置(6E-A3、シャープ(株)製)に設けられている一対の偏光板を剝がし、代わりに市販の偏光板(サンリッツ製LL-82-12WNA)を貼り付けた。 観察者側の偏光板の透過軸と、バックライト側の偏光板の透過軸とは、Oモードとなるように配置した。【0103】得られた偏光板、光散乱フィルムおよび装置について、以下の項目の評価を行った。結果を表1おとびまった。

\* (1)光散乱フィルムの光散乱層 (1-1)ヘイズ

ヘイズメーターNDH-1001DP(日本電色工業 (株)製)を用い、光散乱層の内部ヘイズhiは凹凸面 に透光性樹脂バインダーを塗設して表面凹凸を除くよう にして測定した。表面ヘイズhsは全ヘイズから内部へ イズhiを差し引いて算出した。

(1-2) 表面粗さRa

得られたフィルムの表面粗さは表面粗さ計SE-3C 0 (小坂研究所製)に従って測定した。

[0104] (2) 透光性拡散剂

(2-1)数平均粒径、粒径標準偏差

マスターサイザーX (MALVERN社製) を用いて測定した。

#### (2-2) 粗大粒子数

下記方法で得られたプツ状故障の個数および光学顕微鏡 観察の結果から、個数平均粒径より3.0 μm以上大き な粗大粒子を含有する割合を算出した。

#### ・ブツ状故障

20 各サンプルの基材の塗布層を設けた面の反対面を黒色インキで黒塗りし、塗布面側を上にして目視、光学顕微鏡(倍率:50倍)による面状検査を行い、1平方メートルあたりの目視可能なぶつ状故障の内の倒脂粒子起因のもの(光学顕微鏡により確認)の数をカウントした。【0105】(3)視野角

作製した液晶表示装置について、測定機(EZ-Contrast160D、ELDIM社製)を用いて、黒表示(L1)から白表示(L8)までの8段階で視野角を測定した。

30 【0106】(4)液晶表示装置の面状 15インチサイズの液晶表示装置を作製し、10倍ルー べで識別できる面状故障の数を評価した。

[0107]

【表1】

ひなるにか	しんこ						
液晶	光散乱		透光性樹脂料	<b>全子</b>		光散乱層	
表示装置	フィルム	数平均粒径 (µm)	保準偏差 /平均粒径 (%)	粗大粒子数 (個/1×10°)	内部ヘイズ h i (%)	合計へイズ hi+hs (%)	表面粗さ Ra (μm)
<b>突施闭</b> 1 2 3	HKF-01 HKF-02 HKF-03	3. 5 3. 0 3. 8	16 25 25	2 1 4	5 2 3 6 6 8	6 5 5 3 7 5	0.22 0.10 0.96
比較例 1 2 3	HXF-H1 HXF-H2	1. 9	30 30 -	215 1034 -	1 4 8 2	2 8 9 3 —	0.01 0.16

[0108]

※ ※【表2】

(18)

特開2003-156605

	33			3	34
液晶 表示装置	視野角(コントラスト比≧ 10、 階級反転のない範囲)			液晶表示装置の 面状	視認側の 偏光板
	上	不	左右		
<b>実施例</b>					
1	80*	75°	160°	良好	SHB-01
2	75°	65*	160°	良好	SHB~02
3	80°	70°	165°	良好	SHB-03
比較例					
1	70°	55	140°	面状欠陥 8ヶ所	SAB-H1
2	70*	55°	1 4 5°	面状欠陥15ヶ所	SHB-92
3	50°	25°	110"	面状欠陥 1ヶ所	LL-82-12WNA

(注) 黒側の階間反転: L1とL2との側の反転

【0109】表に示される結果から、本発明の光散乱フィルムを使用した偏光板、液晶表示装置は優れた視野角特性を有すること、特に下方向視野角が拡大していることに加え、面状欠陥がなく、優れた表示品位であることが明らかである。

### [0110]

【発明の効果】本発明の光散乱フィルムを使用した偏光 板を配置した液晶表示装置は、液晶パネルの厚みを厚く 20 することなく、視野角 (特に下方向)が拡大し、視角変 化による、コントラスト低下、階調または黒白反転、お よび色相変化等がほとんど発生することがない。さら に、本発明の光散乱フィルムを使用した偏光板には租大 粒子によるブツ状の面状欠陥がなく、その結果本発明の\*

\*液晶表示装置は表示品位にも使れている。

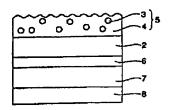
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の好ましい偏光板の層構成を模式的に示す概略断面図である。

【符号の説明】

- 2 透明基材フィルム
- 3 透光性拡散剤
- 4 透光性樹脂バインダー
- 5 光散乱層
- 6 偏光子
- 7 透明基材フィルム
- 8 光学異方性層

[図1]



#### フロントページの続き

Fターム(参考) 2H042 BA02 BA04 BA15 BA20 2H049 BA02 BA06 BA42 BB03 BB33 BB63 BC22 2H091 FA08X FA08Z FA11X FA11Z FA31X FA37X FB02 FC18 FD06